# Собственная фтор-ионная проводимость кристаллических матриц фторидных супериоников: BaF<sub>2</sub> (тип флюорита) и LaF<sub>3</sub> (тип тисонита)

© Н.И. Сорокин, Б.П. Соболев

Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, Москва, Россия

E-mail: nsorokin1@yandex.ru

04

#### (Поступила в Редакцию 2 июля 2018 г.)

Собственная фтор-ионная проводимость  $\sigma_{lat}$  кристаллов BaF<sub>2</sub> (тип флюорита — CaF<sub>2</sub>) и LaF<sub>3</sub> (тип тисонита) исследована методом импедансной спектроскопии. Эти соединения представляют два основных структурных типа, на основе которых образуются лучшие нестехиометрические фторпроводящие твердые электролиты. Проводимость  $\sigma_{lat}$ , обусловленная термоактивированными дефектами, проявляется в области высоких температур, где кондуктометрические измерения осложнены пирогидролизом. Проведение экспериментов в инертной атмосфере и использование методики импеданса позволили впервые получить надежные значения  $\sigma_{lat}$  фторидных кристаллов в условиях подавления пирогидролиза (BaF<sub>2</sub>) или частичного пирогидролиза (LaF<sub>3</sub>). Значения  $\sigma_{lat}$  при 773 К для кристаллов BaF<sub>2</sub> и LaF<sub>3</sub>, выращенных из расплава методом Бриджмена по вакуумной технологии, составляют 2.2 · 10<sup>-5</sup> и 8.5 · 10<sup>-3</sup> S/сm, различаясь в ~ 400 раз. На основе анализа энергетических характеристик процессов образования и миграции анионных дефектов обоснована предпочтительность структурного типа тисонита для создания высокопроводящих фторидных твердых электролитов.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН

DOI: 10.21883/FTT.2019.01.46893.181

### 1. Введение

Наибольший интерес среди фторпроводящих твердых электролитов (ФТЭЛ) представляют нестехиометрические кристаллы  $M_{1-x}R_xF_{2+x}$  и  $R_{1-y}M_yF_{3-y}$ , принадлежащие к двум структурным типам — флюорита (тип CaF<sub>2</sub>) и тисонита (тип LaF<sub>3</sub>) соответственно [1–6]. Их основами являются однокомпонентные матрицы, кристаллизующиеся в этих типах структуры. К простым фторидам со структурой флюорита относятся дифториды CaF<sub>2</sub>, SrF<sub>2</sub>, BaF<sub>2</sub>, CdF<sub>2</sub>, SmF<sub>2</sub>, EuF<sub>2</sub>, YbF<sub>2</sub>, HgF<sub>2</sub> и высокотемпературная форма  $\alpha$ -PbF<sub>2</sub>. Структуру тисонита имеют трифториды LaF<sub>3</sub>, CeF<sub>3</sub>, PrF<sub>3</sub>, NdF<sub>3</sub> и высокотемпературные формы  $\alpha$ -SmF<sub>3</sub>,  $\alpha$ -EuF<sub>3</sub>,  $\alpha$ -GdF<sub>3</sub>. Флюоритовые и тисонитовые ФТЭЛ являются униполярными ионными проводниками, электропроводность которых определяется ионами фтора.

Нестехиометрические фазы  $M_{1-x}R_xF_{2+x}$ И переменным  $R_{1-y}M_{y}F_{3-y}$ числом атомов с В элементарной ячейке образуются в бинарных системах  $MF_2 - RF_3$  (M = Ca, Sr, Ba, Cd, Pb; R — редкоземельные элементы — РЗЭ) [7]. Они являются гетеровалентными твердыми растворами на основе компонентов, поэтому электрофизические характеристики двухкомпонентных ФТЭЛ должны наследовать аналогичные свойства соответствующих компонентов.

По величине фтор-ионной проводимости нестехиометрических кристаллов  $M_{1-x}R_xF_{2+x}$  и  $R_{1-y}M_yF_{3-y}$  предпочтение следует отдавать кристаллам с тисонитовой структурой. Об этом свидетельствуют данные разных исследователей, обобщенные в недавнем обзоре [3].

Можно полагать, что причина такого соотношения проводимостей нестехиометрических кристаллов разного типа структур кроется в процессах дефектообразования в однокомпонентных кристаллических матрицах —  $MF_2$  и  $RF_3$ .

Температурные зависимости ионной электропроводности  $\sigma_{crys}$  для номинально "чистых" ионных кристаллов (в том числе  $MF_2$  и  $RF_3$ ) содержат протяженные низкотемпературные участки  $\sigma_{imp}$ , которые определяются неконтролируемыми примесями. Верхняя граница таких "примесных" участков  $\sigma_{imp}$ , как правило, достигает температур 400–500°С. В результате, собственная проводимость  $\sigma_{lat}$  ( $\sigma_{crys} = \sigma_{lat} + \sigma_{imp}$ ) фторидных кристаллов проявляется в области высоких температур, где их исследования осложнены пирогидролизом (взаимодействием с парами воды), приводящим к конверсии фторидов в оксофториды и оксиды.

Выбор монокристаллов  $BaF_2$  и  $LaF_3$  из всех фторидов  $MF_2$  и  $RF_3$  определялся их кондуктометрическими характеристиками. Кристалл  $BaF_2$  обладает наилучшей ионной проводимостью среди фторидов щелочноземельных элементов (Ca, Sr, Ba). Кристалл  $LaF_3$  из трифторидов РЗЭ по величине проводимости лишь незначительно уступает CeF<sub>3</sub>. Являясь наиболее изученным из фторидов РЗЭ, LaF<sub>3</sub> обладает высокой фтор-ионной проводимостью и применяется в коммерческих фторидселективных электродах для определения концентрации ионов фтора в водных растворах [8] и фтор-ионных источниках тока нового поколения [9,10].

Существующие в литературе экспериментальные данные по высокотемпературным исследованиям  $\sigma_{lat}$  кристаллов BaF<sub>2</sub> [11–16] и LaF<sub>3</sub> [17–20] значительно различаются для каждого. Причинами этого являются неконтролируемые факторы в проведенных экспериментах (примесный состав реактивов, рост кристаллов при разных условиях, термическая предыстория выращенных кристаллов, неконтролируемый пирогидролиз), которые необходимо учитывать при изучении процессов образования и миграции термических дефектов.

Целью работы является сравнение энергетических характеристик образования и миграции анионных дефектов в кристаллических матрицах ФТЭЛ  $BaF_2$  (тип флюорита) и  $LaF_3$  (тип тисонита), полученных из измерений высокотемпературной фтор-ионной проводимости кристаллов, выращенных по одинаковой вакуумной технологии. Предварительные результаты работы докладывались на Первом Российском кристаллографическом конгрессе (Москва, 2016) [21].

# 2. Эксперимент

Для сравнения кристаллов  $BaF_2$  и  $LaF_3$  по  $\sigma_{lat}$  использовали монокристаллы, полученные при одинаковых условиях кристаллизации. Рост кристаллов оптического качества проводился из расплава методом направленной кристаллизации Бриджмена по вакуумной технологии в Государственном оптическом институте (Санкт-Петербург). Методика роста кристаллов приведена в [22,23]. Содержание кислорода в кристаллах  $BaF_2$ и  $LaF_3$  не превышало 120 и 700 *ppmw* соответственно (метод вакуум-плавления [7,24]).

Измерения электропроводности  $\sigma_{dc}$  (dc — direct current) выполнены методом импедансной спектроскопии в диапазоне частот  $10^{-1}-10^7$  Hz (прибор Solartron 1260, 30 mV). В качестве электродов применяли серебряную пасту Leitsilber. Эксперименты проведены в защитной атмосфере азота или в вакууме ~  $10^{-3}$  Ра при температурах 170–1073 К. Пирогидролиз кристаллов контролировали в ходе температурных кондуктометрических измерений по спектрам комплексного импеданса.

Величину  $\sigma_{dc}$  рассчитывали по формуле:

$$\sigma_{dc} = h/(R_b S),\tag{1}$$

где  $R_b$  — объемное сопротивление кристалла. Описание экспериментальной установки дано в [25]. Наличие в спектрах импеданса блокирующего эффекта от инертных (Ag) электродов указывает на преимущественный ионный характер электропроводности. Вкладом электронной и катионной проводимостей в общую электропроводность кристаллов  $BaF_2$  и  $LaF_3$  можно пренебречь [26–28]. Собственная электропроводность  $\sigma_{lat}$  кристаллов  $BaF_2$  и  $LaF_3$  связана со структурным и динамическим разупорядочением анионной (фторной) подрешетки [13,20,29].

Параметры ионного транспорта определяли из температурной зависимости  $\sigma_{dc}(T)$  по формуле Аррениуса– Френкеля

$$\sigma_{dc}(T) = A \exp(-\Delta H_{\sigma}/kT), \qquad (2)$$

где A и  $\Delta H_{\sigma}$  — предэкспоненциальный множитель и энтальпия активации ионной проводимости соответственно.

# 3. Результаты и их обсуждение

#### Собственная проводимость кристаллов BaF<sub>2</sub>

Образец для электрофизических измерений изготавливался в виде плоскопараллельной монокристаллической пластины толщиной h = 1 mm и площадью  $S = 28 \text{ mm}^2$ . Кристаллографическую ориентацию образца не проводили, поскольку кристаллы BaF<sub>2</sub> имеют кубическую симметрию и изотропны по отношению к электрофизическим свойствам.

В табл. 1 приведены термохимические характеристики для BaF<sub>2</sub>. Все кристаллы структурного типа CaF<sub>2</sub> характеризуются "размытым" (диффузным) фазовым переходом типа "порядок-беспорядок", локализующимся в анионной подрешетке. Температура размытого перехода для BaF<sub>2</sub> составляет  $T_{tr} = 1240$  K по [33] и 1275 K по [34], температура плавления равна  $T_{fus} = 1627 \pm 5$  K. При переходе из низкотемпературной формы *l*-BaF<sub>2</sub> ( $T < T_{tr}$ ) в высокотемпературную форму *h*-BaF<sub>2</sub> ( $T > T_{tr}$ ) флюоритовая структура кристаллов (пр. гр.  $Fm\bar{3}m$ ) сохраняется.

Для BaF<sub>2</sub> энтропия плавления  $\Delta S_{fus} = 13.5 \text{ J/(mol} \cdot \text{K})$  и энтропия "размытого" фазового перехода  $\Delta S_{tr} = 14 - 16 \text{ J/(mol} \cdot \text{K})$  по величине практически совпадают. Приведенная в табл. 1 для сравнения  $\Delta S_{fus}$  кристалла MgF<sub>2</sub> (структурный тип рутила TiO<sub>2</sub>,

**Таблица 1.** Температура, энтальпия и энтропия плавления  $(T_{fus}, \Delta H_{fus} \text{ и } \Delta S_{fus})$  и "размытого" перехода  $(T_{tr}, \Delta H_{tr} \text{ и } \Delta S_{tr})$  для кристаллов  $MF_2$  (Ba, Mg) и  $RF_3$  (La, Sc)

	Пла	авление	зление [7,30–32] Фазовый переход [32–3			еход [32–35]
Кристалл	$T_{fus},$ K	$\Delta H_{fus},$ kJ/mol	$\Delta S_{fus}, J/(\mathrm{mol} \cdot \mathrm{K})$	T <sub>tr</sub> , K	$\Delta H_{tr},$ kJ/mol	$\frac{\Delta S_{tr},}{J/(\text{mol} \cdot \text{K})}$
BaF <sub>2</sub>	1627	22	13.5	1275	18.4	14.4
				1200	18.8	15.7
$MgF_2$	1533	58.2	38.0	-	_	_
LaF <sub>3</sub>	1773	50.3	28.5	1650	?	?
$ScF_3$	1825	62.6	34.3	—	—	—



**Рис. 1.** Температурная зависимость  $\sigma_{dc}(T)$  для кристалла BaF<sub>2</sub> при 450–1073 К:  $\sigma_{crys}$  — проводимость кристалла,  $\sigma_{lat}$  — собственная проводимость анионной подрешетки.

пр. гр. P4/mmm), не обладающего "размытым" переходом, составляет ~ 38 J/(mol·K) [36], что значительно больше  $\Delta S_{fus}$  кристалла BaF<sub>2</sub>. В [32] указывалось, что низкая энтропия плавления  $\Delta S_{fus}$  может использоваться как поисковый критерий для супериоников. Низкая энтропия плавления  $\Delta S_{fus}$  во флюоритовых кристаллах  $MF_2$  (M = Ca, Sr, Ba) свидетельствует о значительном разупорядочении анионной подрешетки при "размытом" фазовом переходе.

Согласно нейтронодифракционным данным [37,38] в кристаллах BaF<sub>2</sub> примерно 20–40% фторов смещены из регулярных позиций из-за ангармонических колебаний. Однако, несмотря на значительное разупорядочение анионной подрешетки в высокотемпературном состоянии *h*-*M*F<sub>2</sub> (*M* = Ca, Sr, Ba), число носителей заряда, принимающих участие в ионном переносе при  $T > T_{tr}$ , сравнительно невелико и составляет 1–5% от общего числа фторов [15,16].

Верхняя граница (1073 К) проведенного температурного исследования ниже температуры  $T_{tr}$  на ~ 200 К и не захватывает область сильного разупорядочения анионной подрешетки BaF<sub>2</sub>. Данные по  $\sigma_{dc}$  показали хорошую воспроизводимость в режиме нагрев-охлаждение. Из этого можно сделать вывод, что в ходе измерений пирогидролиз образца практически не наблюдался. Температурная зависимость ионной проводимости номинально "чистого" кристалла BaF<sub>2</sub> при 450–1073 К показана на рис. 1. Протяженность температурного диапазона кондуктометрических измерений равна  $\Delta T_{meas} \approx 620$  К. Математическая обработка зависимости  $\sigma_{dc}(T)$  проводилась в соответствии с уравнением Френкеля–Аррениуса.

Температурный интервал собственной проводимости  $\sigma_{lat}$  матрицы BaF<sub>2</sub> составляет 645–1073 К ( $\Delta T_{cond} \approx 430$  K). В этом диапазоне температур выполняется  $\sigma_{crys} = \sigma_{lat}$  и значения  $\sigma_{lat}$  изменяются от 2.0 · 10<sup>-7</sup> до 1.6 · 10<sup>-2</sup> S/cm (на 5 порядков). Для участка собственной электропроводности  $\sigma_{lat}(T)$  параметры уравнения Френкеля–Аррениуса равны  $A = 6.8 \cdot 10^8$  S · K/cm и  $\Delta H_{\sigma} = 1.64 \pm 0.03$  eV.

Структурный тип флюорита (пр. гр.  $Fm\bar{3}m$ , Z = 4) — 3D-шахматная пространственная архитектура из фторных кубов с параметром a/2 (a — параметр элементарной ячейки), половина которых заполнена катионами. Структура флюорита является весьма "рыхлой". Плотность упаковки анионов в кристалле можно оценить, если использовать приведенный объем элементарной ячейки на один анион  $\Theta_F$  [2]. В случае BaF<sub>2</sub> объем элементарной ячейки на один фтор равен  $\Theta_F = a^3/2Z = 29.8$  Å<sup>3</sup>. Для сравнения плотнейшая упаковка ионов фтора, реализующаяся во фторидах высокозарядных катионов U<sup>4+</sup>, Th<sup>4+</sup>, U<sup>5+</sup> и U<sup>6+</sup>, составляет  $\Theta_F = 17-18$  Å<sup>3</sup> (структурные данные взяты из [39]).

Термостимулированные дефекты в кристаллах фторидов со структурой типа CaF<sub>2</sub> образуются в анионной подрешетке по механизму Френкеля [36]

$$BaF_2 \to F_i^- + V_F^+, \tag{3}$$

где антифренкелевская пара дефектов  $F_i^-$  — междоузельный ион фтора и  $V_F^+$  — вакансия фтора. Энтальпия активации анионного переноса равна

$$\Delta H_{\sigma} = \Delta H_f / 2 + \Delta H_m, \tag{4}$$

где  $\Delta H_f$  — энтальпия образования антифренкелевской пары дефектов и  $\Delta H_m$  — энтальпия активации миграции носителей заряда.

Согласно [25] в кристалле  $BaF_2$  подвижными носителями заряда в примесной области являются междоузельные ионы фтора  $F_i^-$ . Величина энтальпии активации междоузельных ионов фтора  $F_i$  составляет  $\Delta H_m = 0.73 \pm 0.02$  eV [13,25]. Подставив значение  $\Delta H_m$  в выражение (4), получим энтальпию образования антифренкелевской пары дефектов  $\Delta H_f = 1.82 \pm 0.03$  eV. Полученная величина  $\Delta H_f$  хорошо согласуется с приведенными в литературе значениями  $\Delta H_f = 1.81-1.83$  [40,41],  $1.9 \pm 0.1$  eV [11,13,14].

#### Собственная проводимость кристаллов LaF<sub>3</sub>

Образец изготавливался в виде плоскопараллельной пластины с размерами h = 1.4 mm и  $S = 25 \text{ mm}^2$ . Анизотропия электропроводности тригонального кристалла LaF<sub>3</sub> мала, и ею можно пренебречь [20,42], поэтому кристаллографическую ориентацию монокристаллического образца не проводили.

В табл. 1 приведены термохимические характеристики кристалла LaF<sub>3</sub>. Как и в случае флюоритовых *M*F<sub>2</sub>, разупорядочение анионной подрешетки в тисонитовых

кристаллах  $RF_3$  (R = La - Eu) сопровождается, согласно термохимическим данным [35], "размытым" фазовым переходом (по [30,31] измерениями теплоемкости LaF<sub>3</sub> между 100°С и плавлением фазовые превращения не обнаружены). Температура размытого перехода в LaF<sub>3</sub> равна  $T_{tr} = 1377 \pm 25$  К по [35] и 1423 К по [43], а температура плавления составляет  $T_{fus} = 1773 \pm 10 \, \mathrm{K}$  [7]. Значения  $T_{tr}$  и  $T_{fus}$  для LaF<sub>3</sub> превышают на 100–170°С и ~ 150 К соответствующие характеристики для BaF<sub>2</sub>. Высокотемпературный "размытый" переход в тисонитовых кристаллах RF<sub>3</sub> практически не исследован. Предполагается, что при этом переходе происходит симметризация тисонитовой структуры: низкотемпературная тригональная форма *l*-LaF<sub>3</sub> (пр. гр.  $P\bar{3}c1$ , Z=6) трансформируется в высокотемпературную гексагональную форму *h*-LaF<sub>3</sub> (пр. гр.  $P6_3/mmc$ , Z = 2) [44].

В кристаллах нестехиометрических тисонитовых фаз  $R_{1-y}$ Sr<sub>y</sub>F<sub>3-1</sub> (R = La–Nd) этот переход хорошо фиксируется структурным анализом. Его положение зависит от содержания SrF<sub>2</sub>(y) [45,46]. Морфотропный переход l- $R_{1-y}$ Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub>  $\rightarrow$  h- $R_{1-y}$ Sr<sub>y</sub>F<sub>3-y</sub> от большой ячейки (Z = 6) к малой (Z = 2) наблюдается при y = 0.05–0.1.

В табл. 1 приведена для сравнения энтропия плавления  $\Delta S_{fus} = 34.3 \text{ J/(mol} \cdot \text{K})$  [30,31] кристалла ScF<sub>3</sub> (структурный тип ReO<sub>3</sub>, пр. гр.  $Pm\bar{3}m$ ), не обладающего "размытым" переходом, которая лишь незначительно превосходит  $\Delta S_{fus} = 28.5 \text{ J/(mol} \cdot \text{K})$  для кристалла LaF<sub>3</sub>. Это указывает (в отличие от "размытого" перехода в BaF<sub>2</sub>) на малость изменения энтальпии и энтропии при размытом переходе в LaF<sub>3</sub> (в [35] такие изменения энтальпии не обнаружены).

В кондуктометрических экспериментах наблюдалась начальная стадия пирогидролиза кристалла LaF<sub>3</sub> при нагреве до 1073 К. В эквивалентной электрической схеме, моделирующей спектры импеданса, пирогидролиз приводит к появлению поверхностного сопротивления  $R_s$ , параллельно к объемному сопротивлению  $R_b$ . Это зафиксировано также в работах [19,47,48]. Учет сопротивления  $R_s$  позволил выделить из спектров импеданса объемное сопротивление  $R_b$ . Для кристалла LaF<sub>3</sub>  $\sigma_{dc}$ -данные показали хорошую воспроизводимость в режиме нагрев-охлаждение с верхней границей измерений 923 К. В интервале 923–1073 К кондукометрические данные не воспроизводились.

Температурная зависимость ионной проводимости номинально "чистого" кристалла LaF<sub>3</sub> в интервале температур 170–923 К ( $\Delta T_{meas} \approx 750$  К) приведена на рис. 2. На зависимости  $\sigma_{dc}(T)$  наблюдаются три участка. Первые два низкотемпературных участка относятся к примесным областям  $\sigma_{imp}$  [1–3,17,18], а высокотемпературный отвечает собственной ионной проводимости  $\sigma_{lat}$ .

Температурный интервал собственной проводимости  $\sigma_{lat}$  исследованного кристалла LaF<sub>3</sub> незначителен и равен 773–923 К ( $\Delta T_{cond} = 150$  К). В этом диапазоне температур значения  $\sigma_{lat}$  изменяются от  $8.5 \cdot 10^{-3}$ 



до  $3.9 \cdot 10^{-2}$  S/ст (в 4.6 раз). В области собственной электропроводности  $\sigma_{lat}(T)$  параметры уравнения Френкеля–Аррениуса равны  $A = 2.4 \cdot 10^5$  S · K/ст и  $\delta H_{\sigma} = 0.70 \pm 0.03$  eV. Приведенные в литературе значения  $\Delta H_{\sigma}$  для собственной электропроводности LaF<sub>3</sub> сильно различаются: 0.5 [17], 0.8 [19], 0.84 [18], 1.2 eV [20]. Основой причиной этого разброса в значениях  $\Delta H_{\sigma}$  является, по-видимому, неконтролируемый пирогидролиз образцов LaF<sub>3</sub> в проведенных экспериментах.

В низкотемпературной тисонитовой форме l-LaF<sub>3</sub> ионы фтора распределены по трем различным позициям с соотношением F<sub>1</sub>: F<sub>2</sub>: F<sub>3</sub> = 12: 4: 2. Координация F<sub>1</sub> по катионам равна 4, координация F<sub>2</sub> и F<sub>3</sub> составляет 3. Кристаллохимические различия F<sub>2</sub> и F<sub>3</sub> невелики и полностью исчезают в высокотемпературной тисонитовой форме h-LaF<sub>3</sub> (две позиции F<sub>2</sub> и F<sub>3</sub> сливаются в одну). При интерпретации свойств их часто объединяют в общую позицию F<sub>2,3</sub>, тогда соотношение F<sub>1</sub>: F<sub>2,3</sub> = 2: 1. В тисонитовой структуре наиболее вероятными являются перескоки ионов фтора в пределах одного слоя атомов F1 и между слоями атомов F1 через вакантные позиции атомов F<sub>2,3</sub>. В собственной области проводимости в ионном переносе участвует вся фторная подрешетка (F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>, F<sub>3</sub>) [3,20,29].

Структура тисонита (в отличие от флюорита) является плотноупакованной. Кристалл LaF<sub>3</sub> характеризуется высокой плотностью анионной упаковки  $\Theta_{\rm F} = 0.866a^2c/3Z = 18.3$  Å<sup>3</sup>, которая практически совпадает с плотнейшей упаковкой ионов фтора во фторидах высокозарядных катионов ( $\Theta_{\rm F} = 17-18$  Å<sup>3</sup> [39]).



Принято считать, что собственные дефекты во фторидах со структурой тисонита образуются одновременно в анионной и катионной подрешетках по механизму Шоттки

$$LaF_3 \rightarrow 3V_F^+ + V_{La}^{3-}, \qquad (5)$$

где  $V_{\rm F}^+$  — вакансия фтора и  $V_{\rm La}^{3-}$  — вакансия лантана. Энтальпия активации ионного переноса равна

$$\Delta H_{\sigma} = \Delta H_f / 4 + \Delta H_m, \tag{6}$$

где  $\Delta H_f$  — энтальпия образования дефектов Шоттки и  $\Delta H_m$  — энтальпия активации миграции носителей заряда. Однозарядные вакансии  $V_{\rm F}^+$  более подвижны, чем трехзарядные вакансии  $V_{\rm La}^{3-}$ .

Величина энтальпии активации миграции вакансии  $V_F^+$  составляет  $\Delta H_m = 0.26 \text{ eV}$  [18] и 0.28 eV [19]. Подставив среднее значение  $\Delta H_m = 0.27 \text{ eV}$  в выражение (6), получим величину энтальпии активации образования дефектов Шоттки в матрице LaF<sub>3</sub>  $\Delta H_f \approx 1.7 \text{ eV}$ , которая является близкой к энтальпии образования дефектов Френкеля в матрице BaF<sub>2</sub>.

# Сравнение характеристик $\sigma_{lat}$ кристаллов BaF<sub>2</sub> и LaF<sub>3</sub>

Структурные и энергетические характеристики точечных дефектов и характеристики собственной фторионной проводимости кристаллов в  $BaF_2$  и  $LaF_3$  приведены в табл. 2. Общей особенностью кристаллов  $BaF_2$ и  $LaF_3$  является то, что они обладают "размытыми" фазовыми переходами, которые по характеру поведения ионной проводимости отличаются от полиморфных фазовых переходов 1-го рода в YF<sub>3</sub> и LuF<sub>3</sub> [49]. В кристаллах YF<sub>3</sub> и LuF<sub>3</sub> при полиморфных структурных переходах (тип  $\beta$ -YF<sub>3</sub>  $\rightarrow$  тип  $\alpha$ -UO<sub>3</sub> [7]) наблюдается скачок проводимости, обусловленный скачкообразным увеличением концентрации дефектов.

В противоположность сказанному о полиморфных реконструктивных превращениях  $\beta \leftrightarrow \alpha$ -RF<sub>3</sub>, с ростом температуры для кристаллов BaF<sub>2</sub> и LaF<sub>3</sub> характерен непрерывный монотонный рост концентрации дефектов и ионной проводимости. "Размытые" фазовые переходы приводят к быстрому фтор- ионному переносу в них при  $T > T_{tr}$ . Высокотемпературные суперионные формы h-BaF<sub>2</sub> и h-LaF<sub>3</sub> стабилизируются как вниз (прежде всего), так и вверх (немного) по температуре гетеровалентными замещениями: Ba<sup>2+</sup> на  $R^{3+}$  в структуре типа флюорита и La<sup>3+</sup> на  $M^{2+}$  в структуре типа тисонита.

Из сравнения характеристик  $\sigma_{lat}$  кристаллов BaF<sub>2</sub> и LaF<sub>3</sub> следует, что тисонитовая структура обладает более высокой фтор-ионной проводимостью, чем флюоритовая (табл. 2). Значения  $\sigma_{lat}$  кристаллов LaF<sub>3</sub> больше, чем кристаллов BaF<sub>2</sub> в ~ 20 раз при 1000 К и увеличиваются до ~ 400 раз при 773 К. Энтальпия активации  $\sigma_{lat}$  LaF<sub>3</sub>  $\Delta H_{\sigma} = 0.7 \,\text{eV}$  значительно ниже, чем у BaF<sub>2</sub>  $\Delta H_{\sigma} = 1.6 \,\text{eV}.$ 

Можно полагать, что причина этого — сильное различие в степени плотности анионной упаковки этих Таблица 2. Структурные характеристики, параметры собственной фтор-ионной проводимости и энергетические характеристики точечных дефектов в кристаллах BaF<sub>2</sub> и LaF<sub>3</sub>

Характеристики	$BaF_2$	LaF <sub>3</sub>
Пространственная группа	Fm3m,	$P\bar{3}c1$ ,
	Z = 4	Z = 6
Параметры решетки, Å	a = 6.200	a = 7.186
		c = 7.352
Молярный объем, cm <sup>3</sup> /mol	35.87	32.99
Плотность, g/cm <sup>3</sup>	4.89	5.94
Плотность упаковки	29.8	18.3
анионов $\Theta_{\rm F}$ , Å <sup>3</sup>		
Проводимость $\sigma_{lat}$ , S/cm		
при 773 К	$2.2\cdot 10^{-5}$	$8.5 \cdot 10^{-3}$
при 1000 К	$3.5\cdot10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-2}$
		(экстраполяция)
Энтальпия $\Delta H_{\sigma}$ , eV	1.6	0.7
Энтальпия $\Delta H_f$ , eV	1.8	1.7
Энтальпия $\Delta H_m(V_{\rm F}^+)$ , eV	0.5-0.6 [11,13]	0.27 [18,19]
Энтальпия $\Delta H_m(\mathbf{F}_i^-)$ , eV	0.73-0.76 [13,25]	—

структур. Для кристалла LaF<sub>3</sub> она совпадает с предельной упаковкой ионов фтора в высокозарядных фторидах ( $\Theta_F = 17-18 \text{ Å}^3$ ), напротив, для кристалла BaF<sub>2</sub> она значительно выше ( $\Theta_F \approx 30 \text{ Å}^3$ ). В результате в структурах тисонита и флюорита реализуются разные механизмы дефектообразования.

В плотноупакованной структуре тисонитового LaF<sub>3</sub> образуются анионные и катионные вакансии (шотткиевские дефекты), которые уменьшают плотность анионной упаковки. Носителями заряда для  $\sigma_{lat}$  являются подвижные вакансии фтора  $V_{\rm F}^+$ .

В "рыхлой" неплотной структуре флюоритового кристалла  $BaF_2$  точечные дефекты образуются только в анионной подрешетке — междоузельные ионы  $F_i^-$  и вакансии  $V_F^+$  (антифренкелевские дефекты), которые увеличивают плотность анионной упаковки. Носителями заряда для  $\sigma_{lat}$  являются оба типа дефектов  $F_i^-$  и  $V_F^+$ .

Несмотря на близость энергии образования собственных дефектов в тисонитовой матрице LaF<sub>3</sub> ( $\Delta H_f = 1.7 \,\mathrm{eV}$ ) и флюоритовой матрице BaF<sub>2</sub> ( $\Delta H_f = 1.8 \,\mathrm{eV}$ ), энтальпии активации миграции анионных дефектов у них сильно различаются. [15,16]. Энтальпия активации вакансионного движения для тисонитовой структуры ( $\Delta H_m(V_F^+) = 0.3 \,\mathrm{eV}$ ), по крайней мере, в 2 раза меньше, чем для флюоритовой структуры. Поэтому подвижность вакансий  $V_F^+$  в тисонитовых фторидах значительно выше, чем во флюоритовых фторидах.

#### Заключение

Величина  $\sigma_{lat}$  кристаллов LaF<sub>3</sub> превышает фторионную проводимость кристаллов BaF<sub>2</sub> в ~ 400 раз и составляет 8.5 · 10<sup>-3</sup> S/cm при 773 К. Это связано с тем, что подвижность носителей заряда в тисонитовых фторидах значительно выше, чем во флюоритовых фторидах.

Полученные результаты объясняют существенную предпочтительность тисонитовой кристаллической матрицы LaF<sub>3</sub> по величине собственной ионной электропроводности и энергетическим параметрам процесса миграции анионных дефектов для разработки перспективных ФТЭЛ в фундаментальной и прикладной ионике твердого тела.

На основе кристаллических матриц  $BaF_2$  (тип флюорита) и  $LaF_3$  (тип тисонита) образуются лучшие нестехиометрические фторпроводящие твердые электролиты с соответствующими типами структур. Собственная фтор-ионная проводимость  $\sigma_{lat}$  кристаллов  $BaF_2$  и  $LaF_3$ обусловлена термоактивированными дефектами и проявляется в области высоких температур, где кондуктометрические измерения осложнены пирогидролизом. Впервые получены надежные значения  $\sigma_{lat}$  фторидных кристаллов методом импедансной спектроскопии в условиях подавления пирогидролиза.

Авторы благодарят О.В. Глумова (СПбУ, Санкт-Петербург) за предоставленный для исследований кристалл LaF<sub>3</sub>.

## Список литературы

- [1] Н.И. Сорокин, Б.П. Соболев. Кристаллография. **52**, 870 (2007).
- [2] Б.П. Соболев, Н.И. Сорокин. Кристаллография 59, 891 (2014).
- [3] B.P. Sobolev, N.I. Sorokin, N.B. Bolotina. Photonic and electronic properties of fluoride materials / Eds A. Tressaud, K. Poeppelmeier. Elsevier, Amsterdam (2016). P. 465.
- [4] C. Rongeat, M. Anji Reddy, R. Witter, M. Fichtner. Appl. Mater. Interfaces 6, 2103 (2014).
- [5] A. Duvel, J. Bednarcik, V. Sepelak, P. Heitjans. J. Phys. Chem. 118, 7117 (2014).
- [6] J. Chable, B. Dieudonne, M. Body, C. Legein, M. Crosnier-Lopez, C. Galvin, F. Mauvy, E. Durand, S. Fourcade, D. Sheptyakov, M. Leblanc, V. Maisonneuve. Dalton Trans. 44, 19625 (2016).
- [7] B.P. Sobolev. The Rare Earth Trifluorides. Pt 1. The High Temperature Chemistry of Rare Earth Trifluorides, Institute of Crystallography, Moscow and Institut d'Estudis Catalans. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona. Spain (2000). 520 p.
- [8] M.S. Frant, J.W. Ross. Science 154, 1553 (1966).
- [9] А.А. Потанин. Журн. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева XLV, 58 (2001).
- [10] M. Anji Reddy, M. Fichtner. J. Mater. Chem. 21, 17059 (2011).
- [11] E. Barsis, A. Taylor. J. Chem. Phys. 48, 4357 (1968).
- [12] A. Hammou, M. Duclot, V.A. Levitskii. J. Phys. (Paris) 37, 7(1976).
- [13] D.R. Figueroa, A.V. Chadwick, J.H. Strange. J. Phys. C 11, 55 (1978).
- [14] J.D. Oberschmidt, D. Lazarus. Phys. Rev. B 21, 5823 (1980).
- [15] J. Schoonman. Solid State Ionics 1, 121 (1980).
- [16] A.V. Chadwick. Solid State Ionics 8, 209 (1983)

- [17] И.В. Мурин, О.В. Глумов, Ю.В. Амелин. ЖПХ 53, 1474 (1980).
- [18] A. Roos, A.F. Aalders, J. Schoonman, A.F.M. Arts, H.W. de Wijn. Solid State Ionics 9–10, 571 (1983).
- [19] A.V. Chadwick, D.S. Hope, G. Jaroszkiewicz, J.H. Strange. Fast ion transport in solids / Eds P. Vashishta, N. Mundy, G.K. Shenoy. Elsevier North Holland, Amsterdam (1979). P. 683.
- [20] V.V. Sinitsyn, O. Lips, A.B. Privalov, F. Fujara, I.V. Murin. J. Phys. Chem. Solids 64, 1201 (2003).
- [21] Н.И. Сорокин, Б.П. Соболев. Сб. тез. Первого Российского кристаллографического конгресса. М. (2016). С. 413.
- [22] И.В. Степанов, П.П. Феофилов. Рост кристаллов. Изд-во АН СССР, М. (1957). С. 229.
- [23] В.А. Соколов. Тр. ГОИ 54, 21 (1983).
- [24] Г.Г. Главин, Ю.А. Карпов. Завод. лаб. 30, 306 (1964).
- [25] N.I. Sorokin, M.W. Breiter. Solid State Ionics 99, 241 (1997).
- [26] S.N.S. Reddy, R.A. Rapp. J. Electrochem. Soc. 126, 2023 (1979).
- [27] A. Roos, J. Schoonman. Solid State Ionics 13, 205 (1984).
- [28] H.D. Wiemhofer, S. Harke, U. Vohrer. Solid State Ionics 40-41, 433 (1990).
- [29] A.F. Privalov, O. Lips, F. Fujara. J. Phys.: Condens. Matter. 14, 4525 (2002).
- [30] F.H. Spedding, D.C. Henderson. J. Chem. Phys. 54, 2476 (1971).
- [31] F.H. Spedding, B.J. Beaudry, D.C. Henderson, J. Moorman. J. Chem. Phys. **60**, 1578 (1974).
- [32] M. O'Keeffe, B.G. Hyde. Phil. Mag. 33, 219 (1976).
- [33] Р.И. Ефремова, Э.В. Матизен. Изв. СО АН СССР. Сер. хим. **2**, 3 (1970).
- [34] W. Shroter, J. Nolting. J. de Phys. 41, 6 (1980).
- [35] O. Greis, M.S.R. Cader. Thermochim. Acta 87, 145 (1985).
- [36] A.B. Lidiard. Crystals with the fluorite structure / Ed. W. Hayes. Clarendon Press, Oxford (1974). P. 101.
- [37] С.Х. Айтьян, А.К. Иванов-Шиц. ФТТ 32, 1360 (1990).
- [38] S.M. Shapiro. Superionic conductors / Eds G.D. Mahan, W.L. Roth. Plenum Press, N.Y. (1976). P. 261.
- [39] W.H. Zachariasen. Acta Cryst. 1, 265 (1948).
- [40] W. Bollmann. Cryst. Res. Technol. 16, 1039 (1981).
- [41] P.W.M. Jacobs, S.H. Ong. Cryst. Lattice Defects 8, 177 (1980).
- [42] J. Schoonman, G. Oversluizen, K.E.D. Wapenaar. Solid State Ionics 1, 211 (1980).
- [43] P.E. Ngoepe, W.M. Jordan, C.R. Catlow, J.D. Comins. Phys. Rew. B. 41, 3815 (1990).
- [44] O. Greis, D.J.M. Bevan. J. Solid State Chem. 24, 113 (1978).
- [45] Н.Б. Болотина, Т.С. Черная, А.И. Калюканов, И.А. Верин, Н.И. Сорокин, Л.Е. Фыкин, Н.Н. Исакова, Б.П. Соболев. Кристаллография 60, 391 (2015).
- [46] О.Н. Хрыкина, Н.И. Сорокин, И.А. Верин, Н.Б. Болотина, Б.П. Соболев. Кристаллография 62, 559 (2017).
- [47] Н.И. Сорокин, Б.П. Соболев, М. Брайтер. ФТТ 44, 272 (2002).
- [48] Н.И. Сорокин. Электрохимия 41, 1015 (2005).
- [49] M. O'Keeffe. Science **180**, 1276 (1973).

Редактор Т.Н. Василевская